

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ХОЛЛА ДЛЯ ВІВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ З'ЄДНАНЬ A_2B_6

доц. Опанасюк А.С., асп. Курбатов Д.І.,
студ. Гордієнко С.О.

Сутність ефекту Холла, відкритого ще наприкінці минулого століття, полягає в виникненні поперечного електричного поля (різниці потенціалів U_H) в металічній, або напівпровідникової пластині, розміщений в перпендикулярному магнітному полі, при проходженні вздовж неї електричного струму (рис.1).

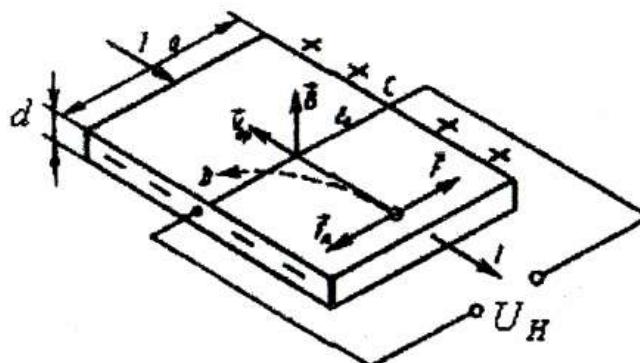


Рисунок 1 - Виникнення холлівської різниці потенціалів U_H в пластині розміщеної магнітному полі.

Кількісно U_H можна визначити так

$$U_H = \frac{R_H BI}{d}, \quad (1)$$

де R_H – коефіцієнт Холла; B – магнітна індукція; I – сила струму, що проходить через зразок; d – товщина пластини.

У фізиці напівпровідників ефект Холла використовується надзвичайно широко, оскільки він є одним з основних методів дослідження параметрів різноманітних матеріалів. Експериментально вимірювши величини U_H , I , B , d , що входять у формулу (1), та знайшовши коефіцієнт Холла, можна визначити концентрацію та рухливість носіїв заряду в напівпровіднику, а за знаком U_H - встановити їх тип.

Для випадку коли електропровідність зразка здійснюється носіями двох різних типів, а це є характерним для напівпровідників, стала Холла дорівнює

$$R_H = \frac{A}{e} \frac{p\mu_p^2 - n\mu_n^2}{(p\mu_p + n\mu_n)^2} = \frac{A}{e} \frac{p - nb_n^2}{(p + nb)^2}, \quad (2)$$

де A - холл-фактор, який залежить від механізму розсіювання носіїв заряду у матеріалі ($A < 2$), e - заряд електрона; n і p - концентрації електронів та дірок; μ_n і μ_p - відповідні рухливості; $b = \mu_n / \mu_p$.

Холлівська рухливість визначається співвідношенням

$$\mu_H = R_H \sigma = \frac{l}{bB} \frac{U_H}{U}, \quad (3)$$

де σ - провідність зразка; l та b - його довжина та ширина відповідно; U - напруга, що прикладається до зразку.

Вивчаючи залежність R_H від температури можна знайти енергію іонізації домішки E_i , а в області власної провідності - ширину забороненої зони матеріалу E_g .

Холлівські дослідження напівпровідникових з'єднань A_2B_6 ускладнюються внаслідок специфіки їх енергетичної

зонної структури. Необхідність врахування трьох типів носіїв заряду приводить до суттєвого ускладнення виразів для визначення провідності та коефіцієнта Холла матеріалу

$$\sigma = (n\mu_p + p_\Gamma\mu_\Gamma + p_L\mu_L),$$

$$R_H = \frac{A}{e} \frac{n\mu_p^2 - p_\Gamma\mu_\Gamma^2 - p_L\mu_L^2}{(n\mu_p + p_\Gamma\mu_\Gamma + p_L\mu_L)^2}, \quad (4)$$

де n_Γ , n_L , p , μ_Γ , μ_L , μ_p – концентрації та рухливості Γ , L дірок та електронів

Але це рівняння у більшості випадків можна спростити врахувавши, що $n_L \gg n_\Gamma$, p або $p \gg n_L$, n_Γ , тоді отримаємо вираз придатний для аналізу $R_H \sim \mu_\Gamma^2 n_\Gamma / \sigma^2$.

Для дослідження електрофізичних властивостей плівок з'єднань A_2B_6 нами створена установка, яка дозволяє проводити вимірювання U_H в вакуумі в інтервалі температур $T = 100-700$ °К та магнітних полів $B = 0-0,2$ Тл.

Використана схема вимірювань холлівської напруги у постійному магнітному полі при постійних струмах, що проходять через зразок. Для запобігання впливу супутніх ефектів вимірювальна схема передбачає можливість зміни напрямку струму через зразок та полярності магнітного поля.

Передбачена можливість вимірювань параметрів халькогенидів при освітленні зразків світлом визначеної довжини хвилі, що дозволяє проводити дослідження в високоомних та напівізолюючих плікових конденсатах.